

第43回 UV/EB研究会

ON
SA

ご 案 内

第1部 講演会 14:00～

1. 高強度レーザー誘起放射線(電子・イオン)の現状と工業分野への展開について

光産業創成大学院大学 光産業創成科 光加工・プロセス分野 沖原 伸一郎

低重量・省スペースのレーザー装置で数 MeV 以上の粒子線を発生できる。近年では重イオンビームや単色電子ビーム発生等、用途開発向けの研究もなされている。世界的な研究や装置開発の進展を踏まえ、工業分野への実用化には至っていないが、次世代の技術として期待されている。講演では、レーザー誘起放射線研究の現状と、最新レーザー装置の開発状況、既存の工業分野への応用の可能性について概説する。

2. 超低エネルギー電子線照射源 EB-ENGINE®の開発と応用

浜松ホトニクス株式会社 電子管事業部 第5開発G 松井 信二郎

従来産業に用いられてきた加速電圧数百 kV～数 MV の高エネルギー電子線はその飛程が数百 μm ～数 mm あり、深さ方向への透過率が高いという反面、薄膜のごく表面などにおいてはエネルギー吸収効率が低く、且つ改質不要な深部にまで電子線が到達してしまう問題があった。浜松ホトニクス(株)が開発した EB-ENGINE®は、加速電圧 40～110 kV の超低エネルギー電子線を大気中に取出し、従来の高エネルギー電子線照射源よりもはるかに高効率で薄膜の表面のみへの電子線照射を可能にする。講演では、主にこの超低エネルギー電子線照射の特長とその応用について紹介する。

3. イオン注入法を用いた高分子材料の処理

株式会社イオンテクノセンター 常務取締役 長町 信治

高エネルギービームを用いた高分子材料の改質には主に電子線、X線が用いられてきた。過去にはイオンビームを用いて改質する試みもいくつかおこなわれたが、実用化されるには至っていない。改めてイオンビームと電子線、X線の違いを整理すると同時に、イオンビームの持つ可能性について議論する。

第2部 技術交流会 17:00～

主催：(社)大阪ニュークリアサイエンス協会
日時：2009年11月20日(金) 14:00～18:30
場所：住友クラブ(裏面参照)
第1部参加費：6,000円 但し、協会会員及びUV/EB会員 3,000円
大学・公設研究機関 2,000円、
放射線科学研究会会員・学生 無料
第2部参加費：3,500円

第 43 回 UV/EB 研究会 平成 21 年 11 月 20 日(金)14:00~18:30

研究会参加申し込み票

(宛先)大阪府中央区北久宝寺町2丁目3-6非破壊検査ビル5F
(社)大阪ニュークリアサイエンス協会

FAX:06-6262-6541, TEL:06-6262-6540, e-mail: onsa-ofc@nifty.com

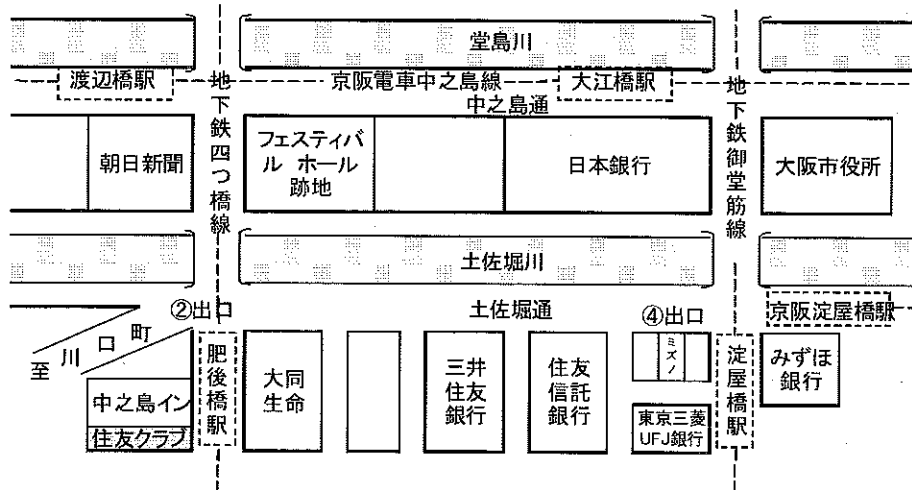
- *お手数ですが、それぞれの出・欠、どちらかに○を付け、FAXでお申込み下さい。
- *e-mailの可能な方はご連絡先にアドレスもお書き下さい。今後のご案内を差し上げます。
- *お申込は準備の都合上なるべく早い目をお願いします。

なお、交流会ご出席のお申込を頂き、後日キャンセルされる場合は研究会の3日前までにお願いたします。

ご氏名	ご連絡先(所属)	講演会	技術交流会
		出欠	出欠
		出欠	出欠
		出欠	出欠

研究会会場：住友クラブ

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-10 TEL06-6443-1986



地下鉄四つ橋線肥後橋駅下車②出口よりすぐ
 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車④出口西へ徒歩5分
 京阪電車中之島線渡辺橋駅下車7号出口より四つ橋筋を南へ徒歩3分
 (7号出口は長い階段です。地上へはエスカレーターまたはエレベーターをご利用下さい)
 駐車場設備がありませんので、車でのご来館はご遠慮下さい